

シリカガラスの最前線 The forefront of silica glass

開催日時 2018 年 9 月 20 日(木) 13:30~18:00(予定)

シリカガラス(非晶質シリカ)は透明性、化学的耐久性、機械的強度、照射耐性などに優れており、光ファイバー、ファイバーレーザー、光リソグラフィ用硝材など、高度な特性を要求されるガラスとして重要であるとともに、シリコンデバイスの絶縁膜などとしても利用されています。古くから知られた物質でありながら、先端技術を支える基盤材料でもあるシリカガラス研究の現状、工学応用と将来展望について、第一線でご活躍の先生方にご講演頂きます。多数のご参加をお待ちしています。

基調講演(45 分)

- Minoru Tomozawa (Rensselaer Polytech. Inst.)
Surface Stress Relaxation of Silica Glass

招待講演(30 分)

- 葛生 伸 (福井大)
接合したシリカガラス間の OH 基の拡散
 - 佐藤 友子 (広島大)
高圧下におけるシリカガラスの変形挙動
 - 金 鋼 (大阪大)
ガラス転移の劇的スローダウン：分子シミュレーションによるシリカガラスと金属ガラスを俯瞰的に理解する試み
 - 内野 隆司 (神戸大)
シリカ中の欠陥中心が関与する多彩な発光現象
 - 長谷川 健美 (住友電工)
通信用光ファイバーの現状と今後の展望
- ✓ 一般講演も募集します。ぜひご投稿ください。
✓ 講演タイトルは変更されることがあります。

世話人: 梶原 浩一 (首都大)、斎藤 全 (愛媛大)